

関東電化工業株式会社 個人投資家様向け会社説明会

2026年3月16日
(東証プライム市場 4047)



関東電化工業
KANTO DENKA KOGYO

1. 会社概要

2. 事業概要・成長戦略

3. 中計進捗・資本政策・株主還元

当社の使命

危険性の高い化学物質を社会に役立つ製品や技術として提供する役割を担う

当社のコア技術

電解技術および得られるフッ素、塩素、水素等の誘導品合成技術



代表取締役社長
長谷川 淳一

設立

1938年

本社

東京都
千代田区

上場市場

東証プライム
(化学)

国内工場

群馬・岡山
渋川市 倉敷市

海外工場

韓国・中国
天安市 宣城市

連結従業員数

1,177名

連結子会社

7社
(国内3、海外4)

売上高

623億円

営業利益

42億円
(6.9%)

ROE

5.0%

当社発展の歴史・技術の変遷

創業期

戦後高度成長期

1970年代

1980年代以降

マグネシウム電解精錬

食塩電解（か性ソーダ、塩素、水素の活用）

フッ化水素の電解による
フッ素の活用



金属マグネシウム電解槽



トリクロロールエチレン製造設備



メタル磁気テープ用磁性合金粉



半導体用ドライエッチングガス



か性ソーダ煮詰工場の建設工事



食塩電解設備



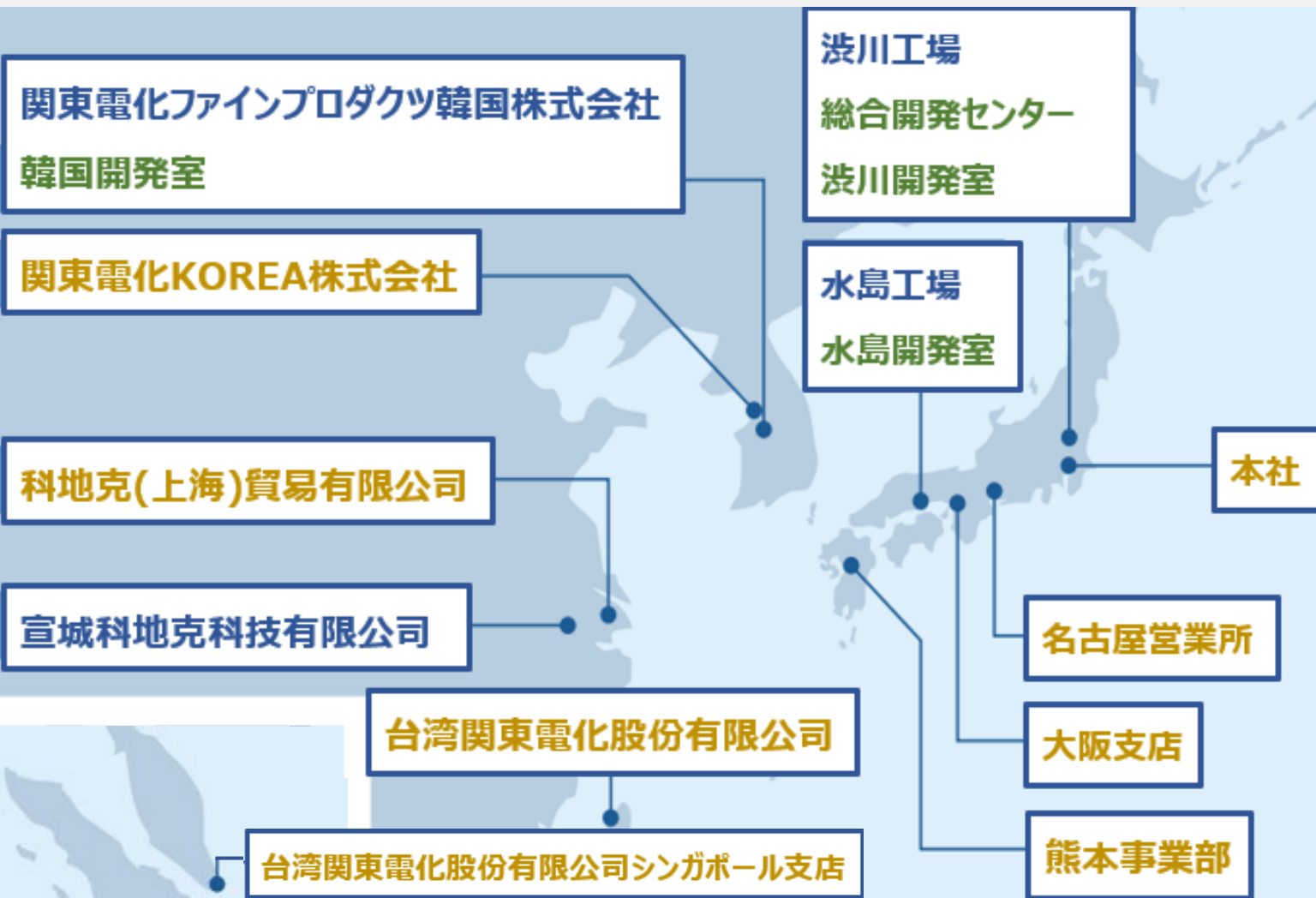
複写機用キャリアー



リチウムイオン2次電池用電解質

拠点一覧

- ・国内9拠点：製造拠点2、研究拠点3、販売拠点4
- ・海外7拠点：製造拠点2、研究拠点1、販売拠点4



製造拠点 (4)

渋川工場 (群馬県渋川市)
水島工場 (岡山県倉敷市)
韓国工場 (韓国天安市)
中国工場 (中国宣城市)

研究拠点 (4)

総合開発センター (群馬県渋川市)
渋川開発室 (群馬県渋川市)
水島開発室 (岡山県倉敷市)
韓国開発室 (韓国天安市)

米国開発拠点をリサーチ中

販売拠点 (8)

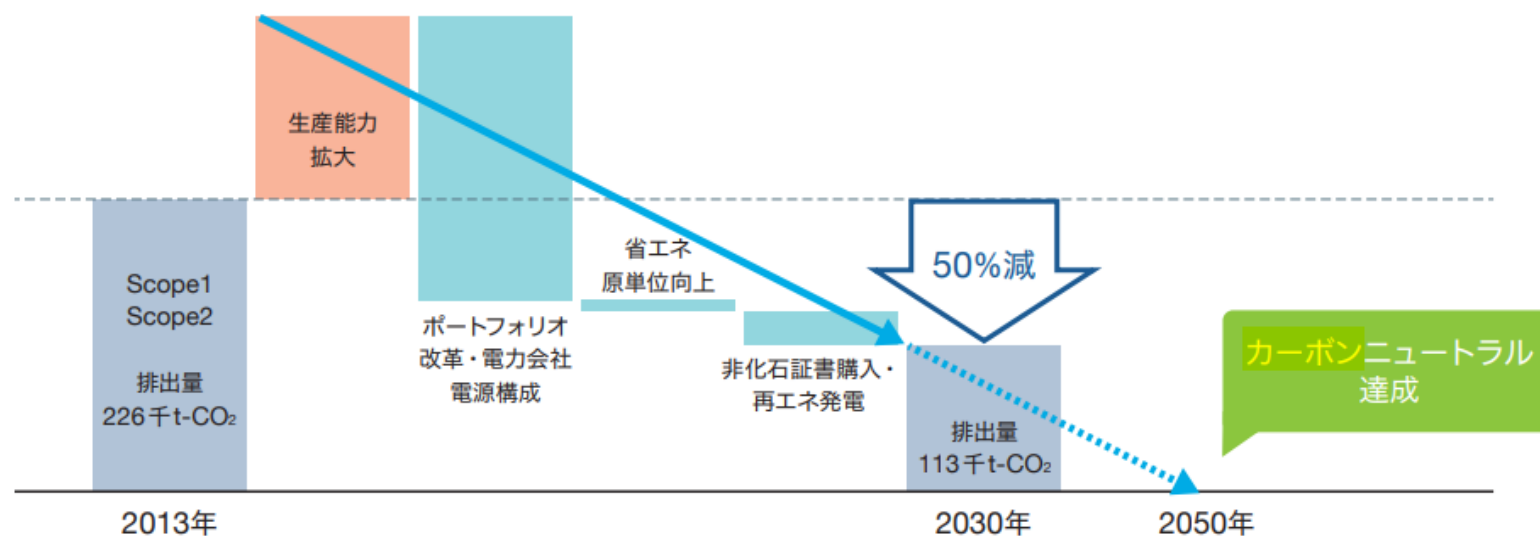
本社(東京)、大阪支店、名古屋営業所、熊本事業部
韓国(ソウル)、中国(上海)、台湾(新竹)、シンガポール

2050年カーボンニュートラルの達成

2030年のありたい姿

安定した経営基盤のもと、安全で働きがいを実感できる環境を提供し、独自性・優位性ある製品で世界最先端の技術を支え、サステナブルな社会に貢献する『**創造的開発型企业**』へ成長する

エネルギー由来温室効果ガス削減ロードマップ

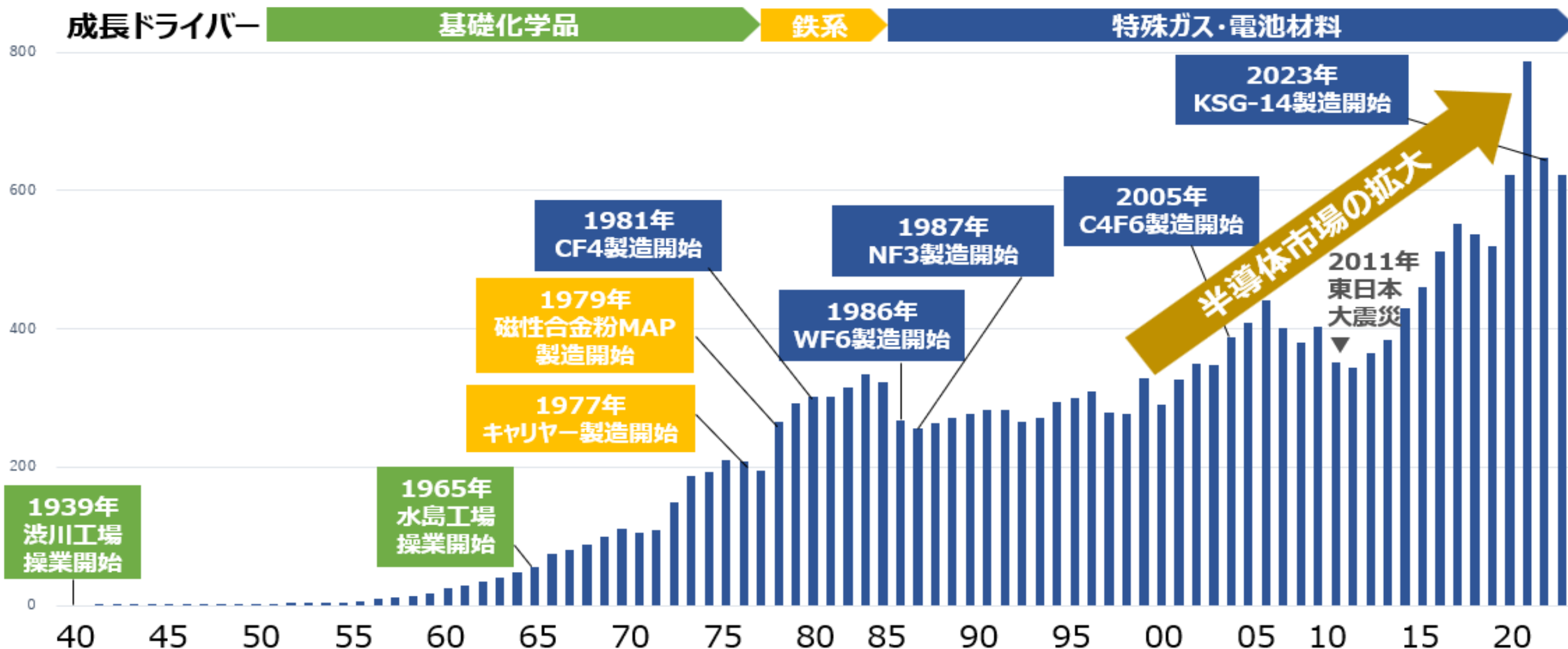


売上高の推移



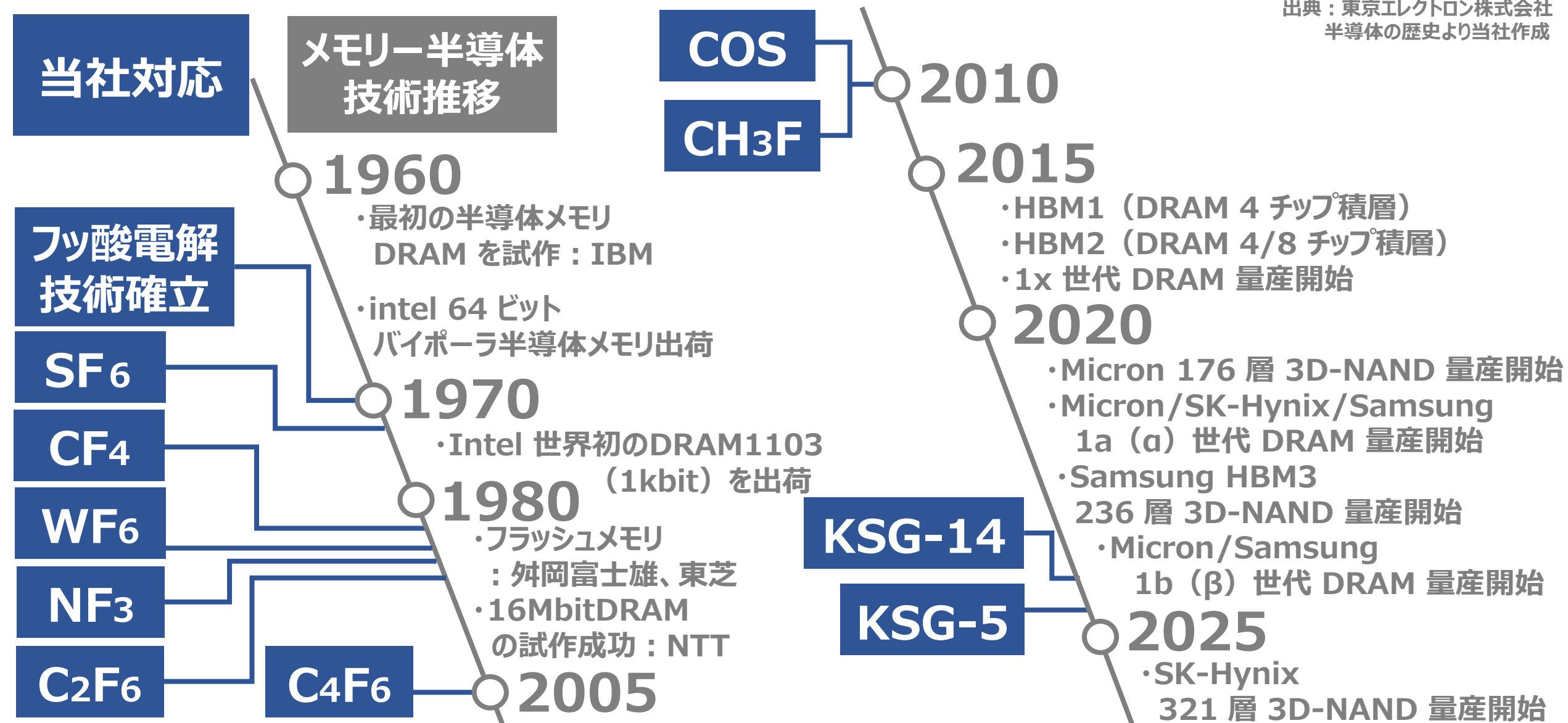
関東電化工業
KANTO DENKA KOGYO

- ・時代のニーズに応えるため、時代に応じて成長ドライバーを変えることで、成長を加速
- ・近年は半導体市場の拡大により大きく伸長



メモリー半導体の技術進化と当社の対応

出典：東京エレクトロン株式会社
半導体の歴史より当社作成





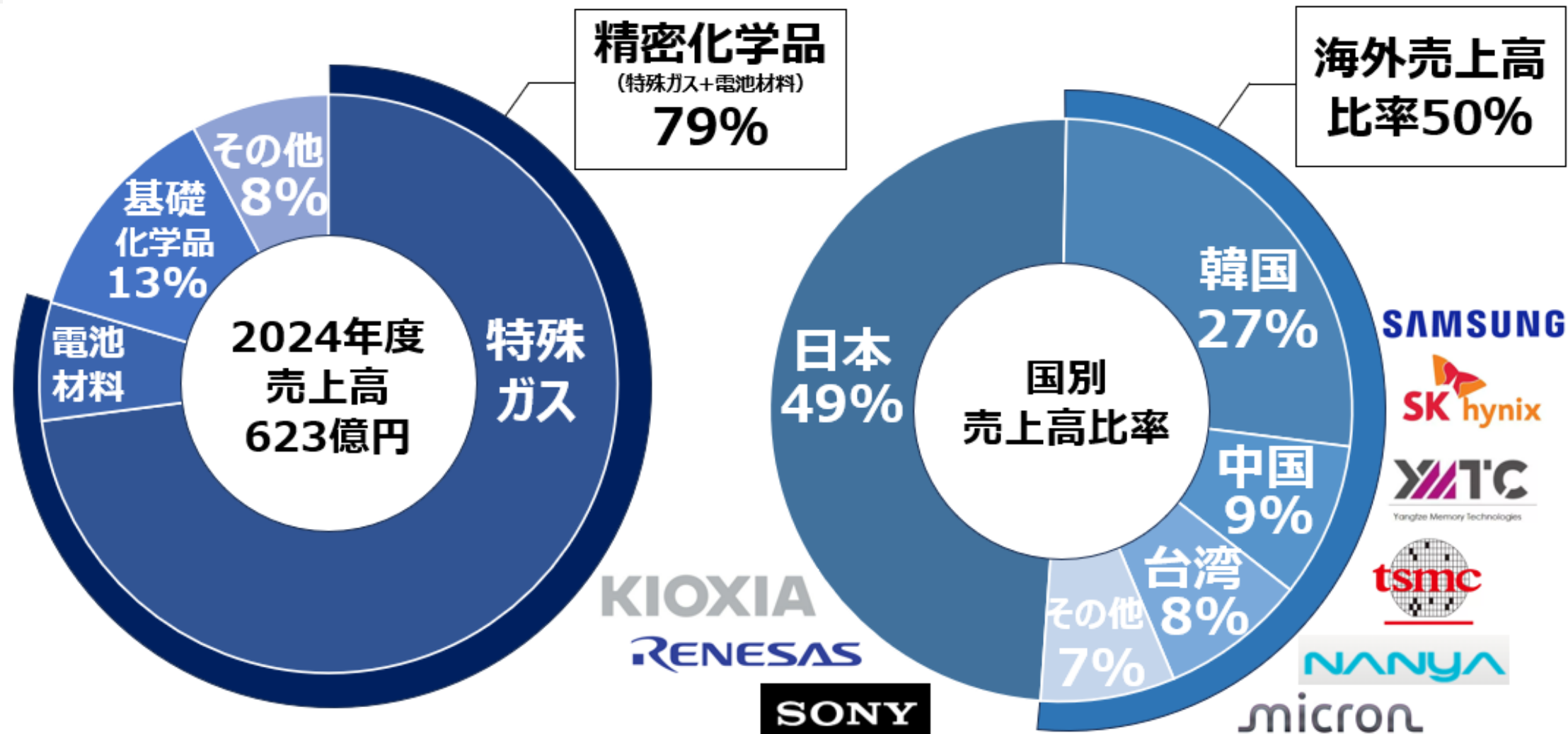
1. 会社概要

2. 事業概要・成長戦略

3. 中計進捗・資本政策・株主還元

事業の構成

- ・売上高の約 8 割が精密化学品事業
- ・海外売上高は約5割であり、ほぼ全ての半導体メーカーへ販売



特殊ガス（主要ガス）

- ・特殊ガスの売上高のうち、メモリー半導体向けが65%、ロジック半導体向けが35%
- ・メモリー半導体向け65%のうち、NAND向けが40%、DRAM向けが25%

	ロジック 半導体 特殊ガスの売上高のうち 35%	メモリー 半導体 特殊ガスの売上高のうち 65%		生産 拠点	特殊ガスの 売上高に 占める 構成比	摘要 () は世界シェアの順位
		DRAM 特殊ガスの売上高のうち 25%	NAND 特殊ガスの売上高のうち 40%			
NF3 三フッ化窒素	○	○	○	渋川	約25%	製造能力：3,700t/y シェア：10%（4位） 大手半導体向けは20%
	クリーニング用途					
WF6 六フッ化タングステン		○	○	渋川 中国	約15%	製造能力：1,400t/y シェア：20%（3位）
	プリカーサー用途					
C4F6 ヘキサフルオロ-1,3 -ブタジエン			○	渋川 水島 中国	約30%	製造能力：600t/y シェア：40%（1位）
			エッチング用途			
COS 硫化カルボニル			○	渋川 韓国	約5%	製造能力：200t/y シェア：60%（1位）
			エッチング用途			
KSG-14			○	水島	2025年度 より本格販売	製造能力：150t/y シェア：100%（1位） キオクシア(株)との共同開発
			エッチング用途			



特殊ガス（その他のガス）

・多くの製品品種を備えているのは当社のみ

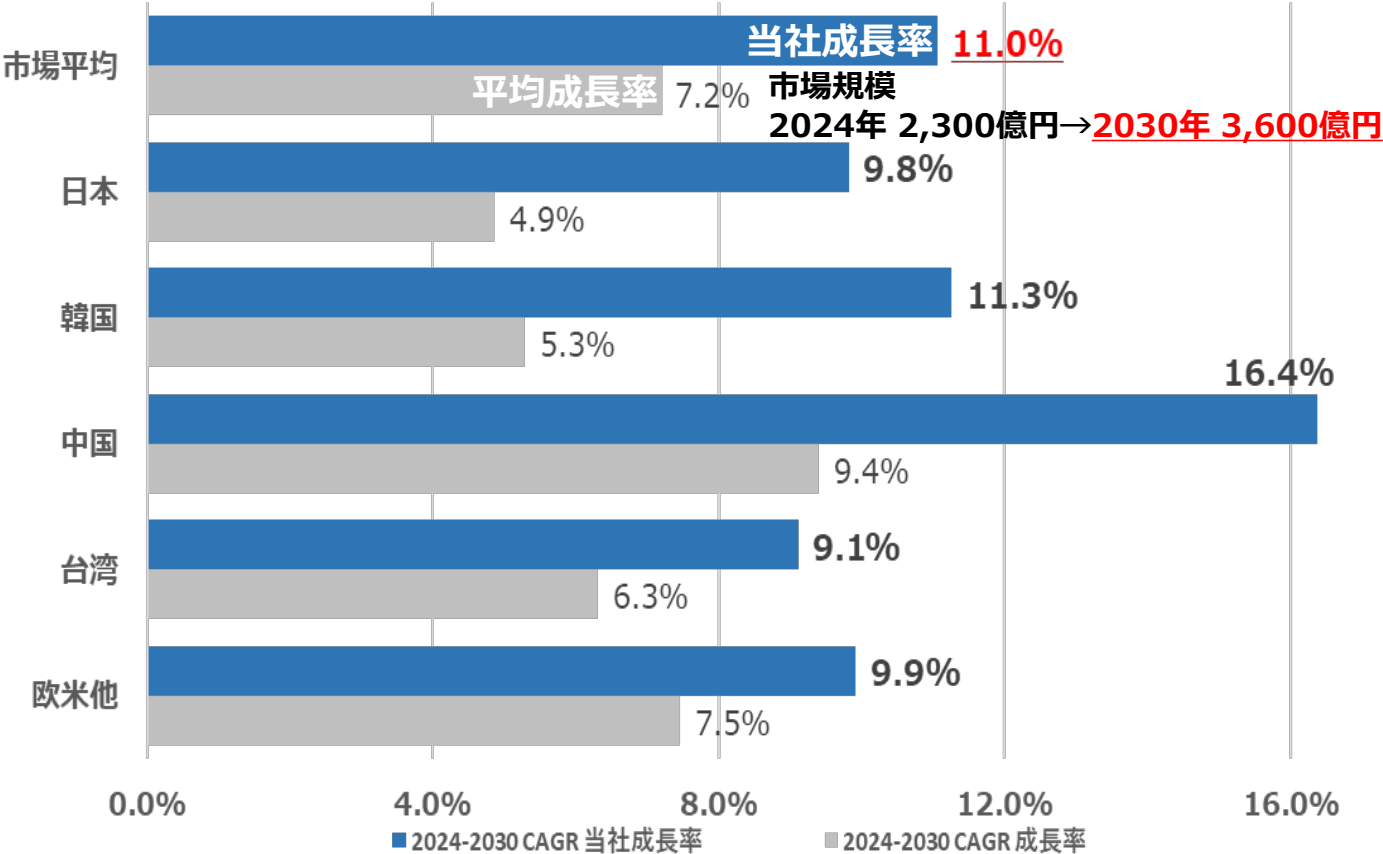
用途	製品名	生産拠点	用途	製品名	生産拠点
エッチングガス	SF ₆ 六フッ化硫黄	渋川	エッチングガス	C ₄ F ₈ 八フッ化シクロブタン	渋川
	CF ₄ 四フッ化炭素	渋川 韓国 中国		CH ₂ F ₂ ジフルオロメタン	渋川
	C ₂ F ₆ 六フッ化エタン	渋川	クリーニングガス	C ₃ F ₈ 八フッ化プロパン	渋川
	CHF ₃ トリフルオロメタン	渋川		ClF ₃ 三フッ化塩素	水島 韓国
	CH ₃ F モノフルオロメタン	渋川		F ₂ -mix フッ素混合ガス	渋川
	KSG-5	渋川	プリカーサー 光ファイバー	SiF ₄ 四フッ化ケイ素	水島



特殊ガスの今後の見通しと戦略

- 半導体エッチング&クリーニングガスの市場規模は2030年に3,600億円*に成長見込
- 当社CAGR(2024-2030年)は市場平均7.2%*に対し11.0%を想定
- 当社目標シェア(2030年)は25%以上

*当社予想



	施策・戦略
日本	渋川・水島工場の生産設備拡大 KSGシリーズの販売拡大
韓国	韓国工場の生産拡張、品種拡大、新製品投入 韓国開発拠点の活性化
中国	中国工場稼働本格開始 韓国工場、渋川・水島工場との連携生産 中国協力企業との連携
欧米他	ライセンスを含めた生産拠点の検討開始 設備メーカー、顧客との開発へ拠点新設検討

- ・リチウム二次電池に必要な不可欠な電解質や添加剤を製造
- ・電解質であるLiPF₆は日本国内で唯一製造

用途	製品名	生産拠点	摘要
電解質	LiPF₆ 六フッ化リン酸リチウム	水島	・国内唯一の製造メーカー ・生産能力：5,400t/y → 8,000t/y 増強中 ・生産国では中国が90%以上のシェア ・中国以外では、当社を含め2社のみが製造
	LiBF₄ ホウフッ化リチウム	水島	・国内唯一の製造メーカー ・生産能力：30t/y ・電池特性向上(長寿命化等)
添加剤	LiPO₂F₂ ジフルオロリン酸リチウム	水島	・国内唯一の製造メーカー ・生産能力：160t/y ・電池特性向上(長寿命化等)
	リチウムイオン二次電池用 新規添加剤	水島	・NEDO 蓄電池の安定供給の確保の助成金採択済 ・生産能力：蓄電池 65GWh/y 相当 ・2026年3月期Q4 設備完成予定 ・2027年3月期Q3より販売開始予定

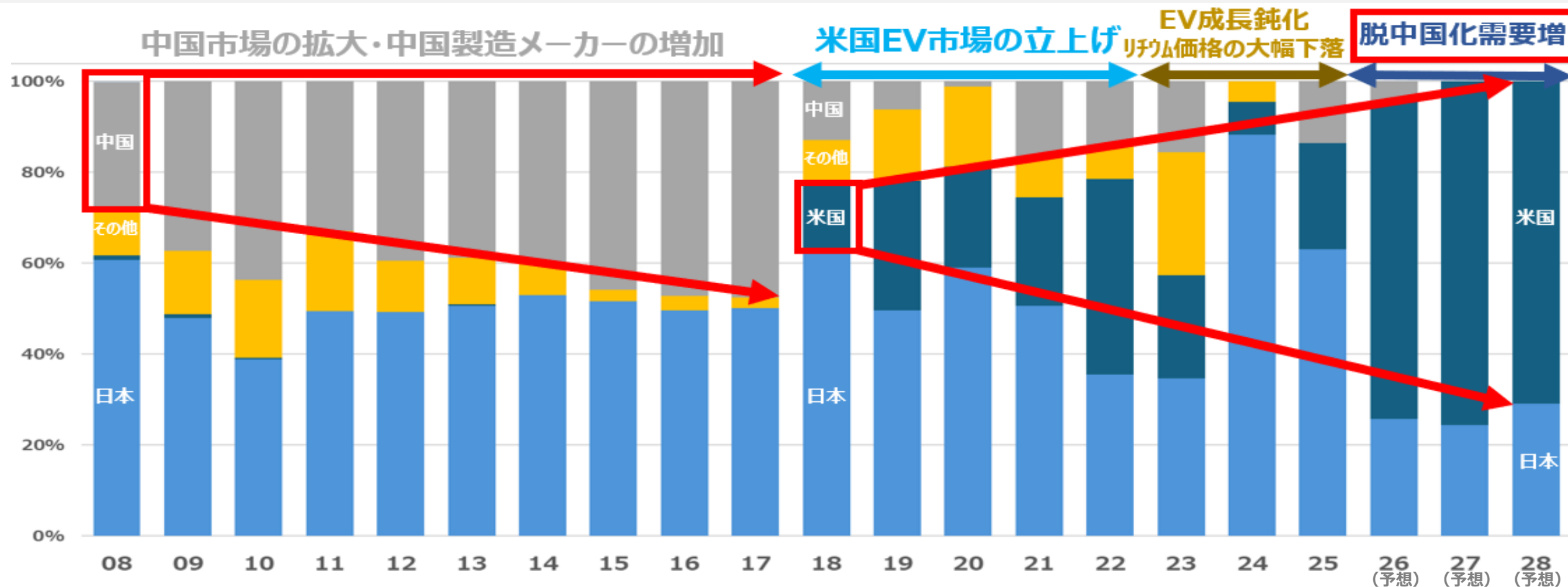


LiPF₆ 国別売上高比率の推移



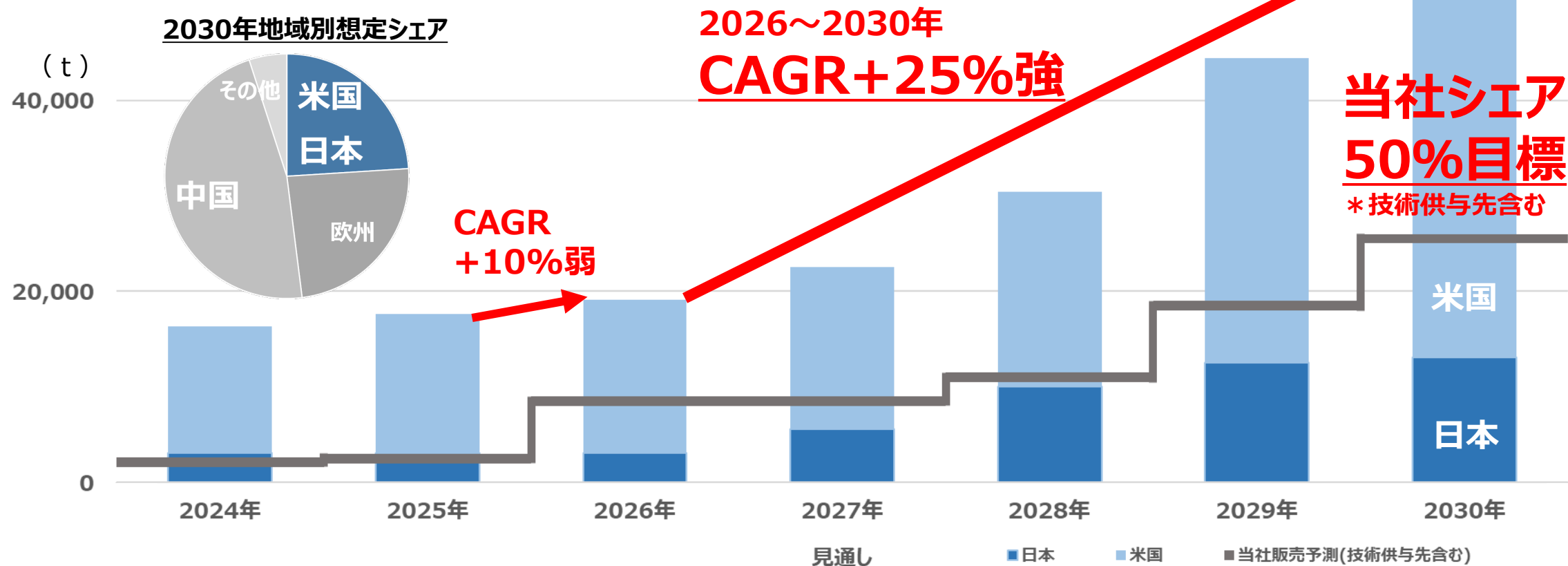
関東電化工業
KANTO DENKA KOGYO

- ・2017年度までは、中国電池市場の拡大のなか、中国販売比率が増加
- ・2018年度以降は、米国のEV市場の立上がりにより、米国販売比率が増加
- ・2023年度以降は、EVの成長鈍化による需給バランスの悪化により、市場全体が大幅に悪化
- ・2026年度以降は、脱中国化の流れに沿った米国を中心とした新たな需要の拡大により、大幅な回復を見込む



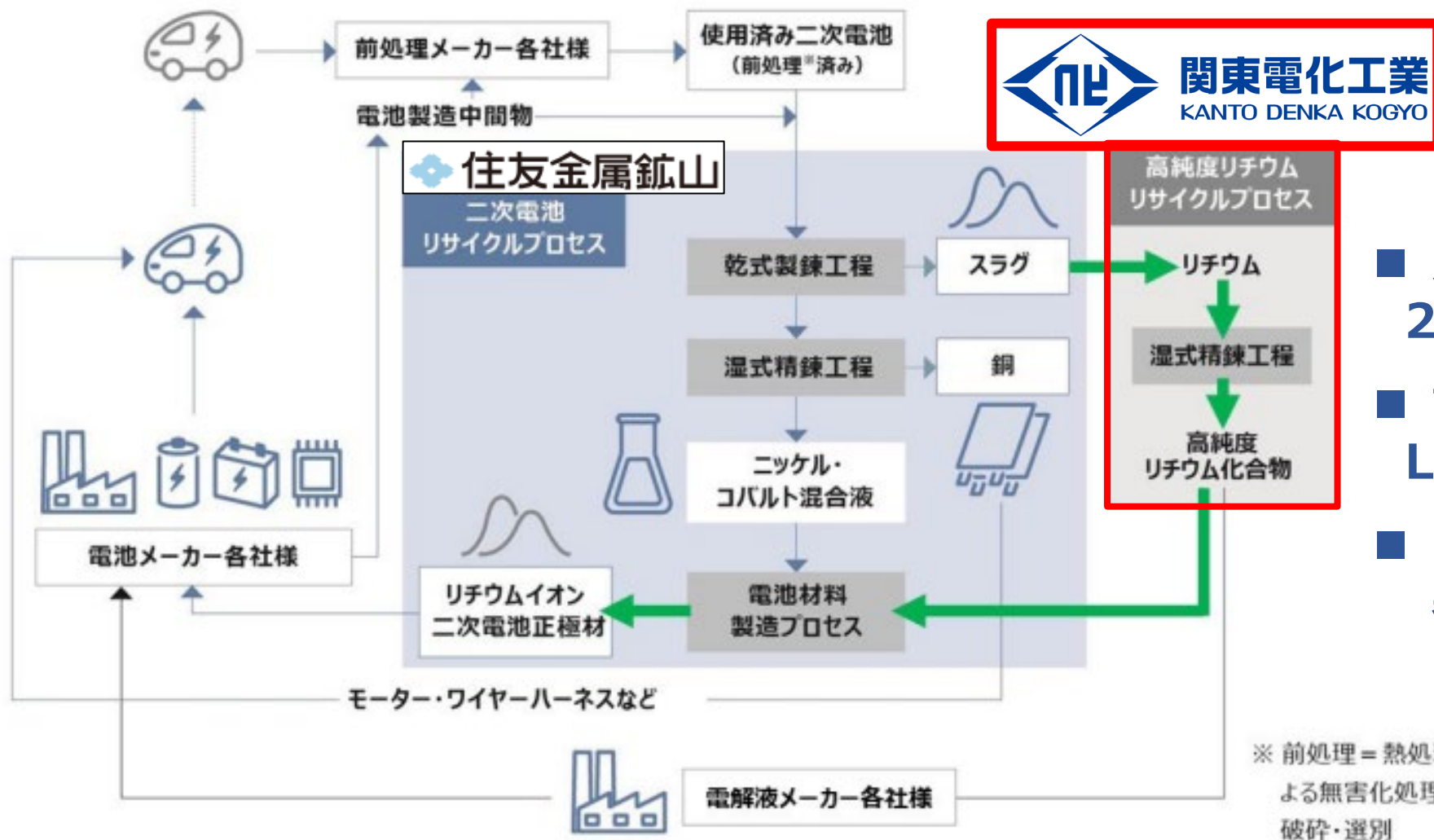
今後の電池材料（LiPF₆）の見通し

- 当社が狙う市場は米国 & 日本市場
- 米国 & 日本市場は2030年に50,000 t *に成長見込 *当社予想
- 脱中国化サプライチェーン（原料、製造）を構築 + Liリサイクルを進める



リチウムリサイクル

- ・リチウム含有スラグを再資源化し、高純度リチウム化合物として再利用する技術を世界で初めて確立
- ・2027年10月の完成を予定、設備能力（原料処理量）はLIBセル換算で約5,000t/y



- 完成時期
2027年10月設備完成
- 設備能力
LIBセル換算で約5,000t/年
- NEDO グリーンイノベーション
基金事業の助成金採択済

※ 前処理 = 熱処理等による無害化処理および
破碎・選別

LiPF₆の技術供与（戦略的技術提携）

- ・米国メキシケム社へLiPF₆の技術供与を行い、対価としてロイヤリティを受領

日本



関東電化工業
KANTO DENKA KOGYO

LiPF₆ 製造設備

技術供与

ロイヤリティ

米国

orbis

（メキシケム社）



★
ルイジアナ州
セントガブリエル

基礎化学品事業

- ・食塩電解による苛性ソーダに併産される塩素は、当社精密化学品の重要な原料
- ・基礎化学品事業の安定は当社事業の基盤であり、将来に向けた原料供給機能を継続

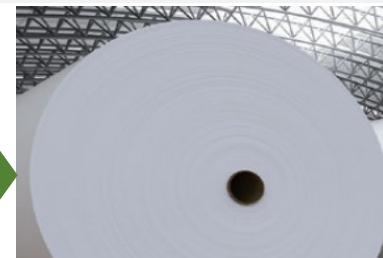
中期経営計画の戦略

精密化学品事業への原料供給機能の強化

無機製品



苛性ソーダ/塩酸/次亜塩素酸ソーダ等



紙パルプの製造：苛性ソーダ
紙の漂白：次亜塩素酸ソーダ



水の処理：苛性ソーダ、塩酸、
次亜塩素酸ソーダ

有機製品



トリクロロエチレン/パークロールエチレン/
塩化ビニリデン等



金属の洗浄：
トリクロロエチレン
パークロールエチレン



冷媒の原料：
トリクロロエチレン

安定した黒字化

精密化学品への
原料供給機能

基礎
化学品
13%

2024年度
売上高 623億円

基礎化学品
売上高 79億円

鉄系、商事、設備

- ・鉄系事業は、渋川工場で製造していた複写機用キャリアを関東電化ファインテックに生産移管
- ・商事事業は当社製品の販売、当社向け原材料の購入、設備事業は化学設備関連および一般産業の工事を行う

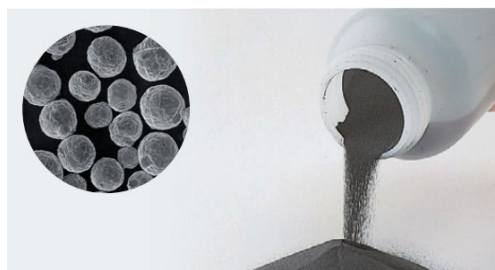
鉄系事業、設備事業、設備事業

鉄系



株式会社 関東電化ファインテック
KANTO DENKA FINETECH CO.,LTD.

所在地：三重県伊賀市



その他
8%

2024年度
売上高 623億円

その他
売上高 48億円

商事

関電興産株式会社
KANDEN KOSAN CO.,LTD.

所在地：東京都中央区

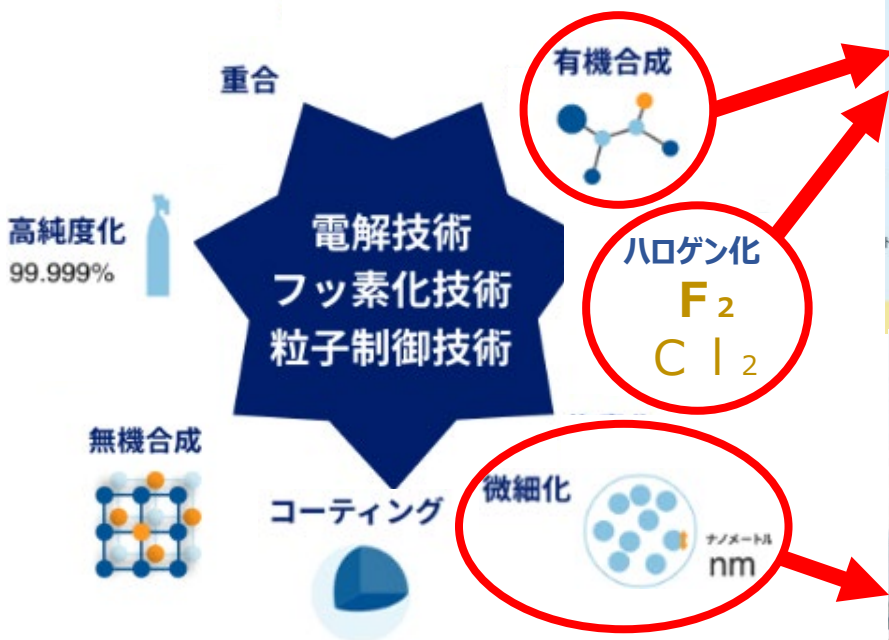
設備

IOBI 株式会社 上備製作所

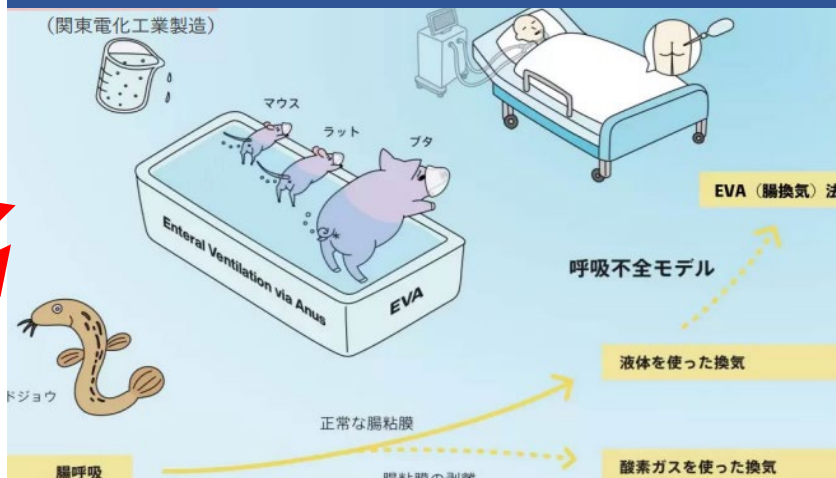
所在地：東京都千代田区

- ・腸換気法で当社技術によるパーフルオロカーボンが採用見込
- ・微細化技術を活かした高屈折材料を開発、次世代AI スマートグラスのようなデバイスでの使用を想定

当社コア技術



フッ素化学による腸呼吸の実現へ



腸換気技術を用いた新たな呼吸管理法の開発

- 東京科学大学の武部貴則教授らの研究チームによって発明
- 腸換気技術は2024年に**イグノーベル賞**を受賞
- 当社はコアとなる医療材料パーフルオロカーボンを供給

次世代AIスマートグラス



ナノ高屈折材料

- 独自技術により、ナノ微粒子表面性質制御技術による高屈折材料を開発中

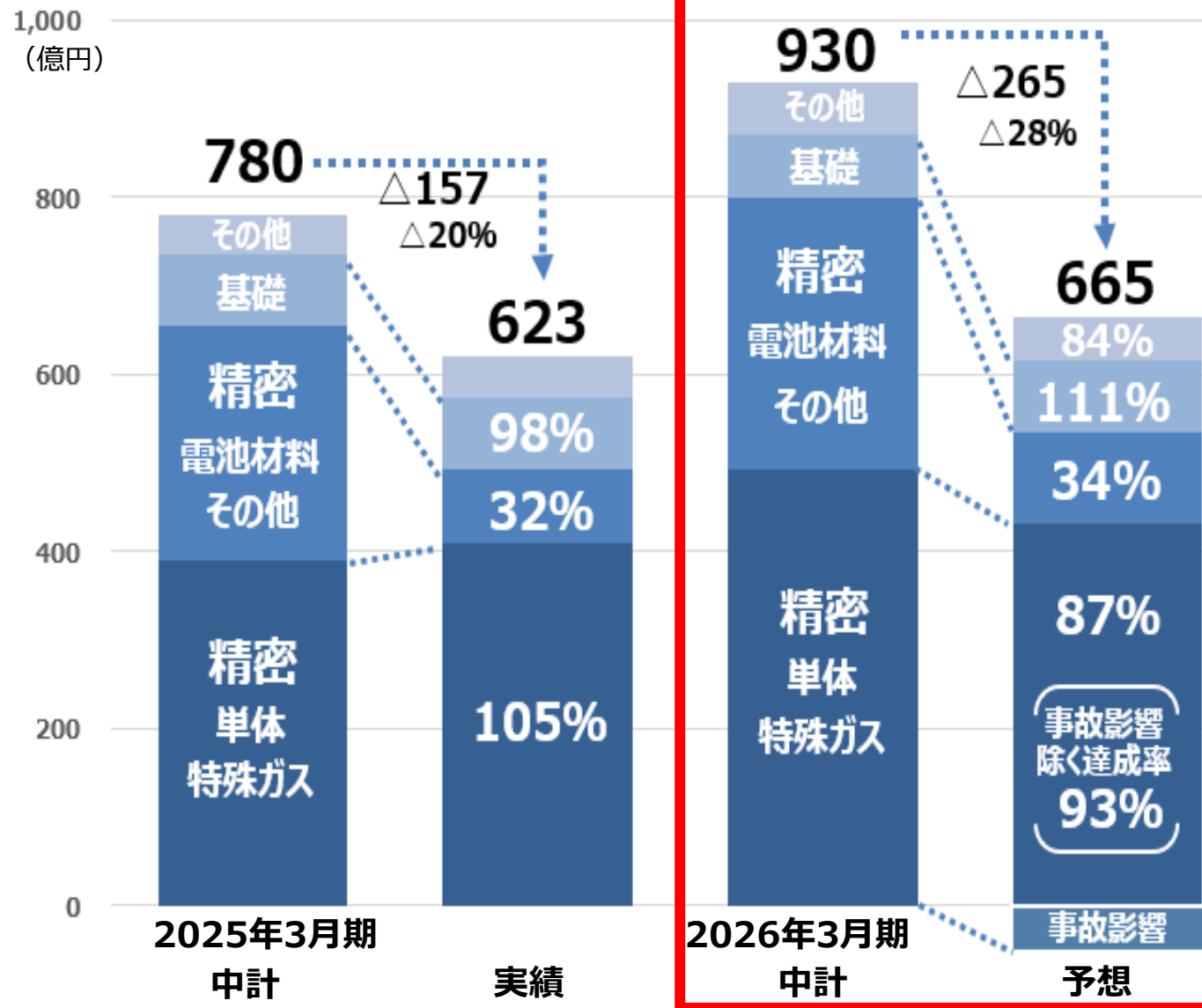


1. 会社概要

2. 事業概要・成長戦略

3. 中計進捗・資本政策・株主還元

中期経営計画との差異



【2026年3月期 中計達成率と要因】

■ 基礎化学品：達成予想 111%

中計では、原料供給部門として事業を再構築を計画していたため、販売数量減を想定していたが、まずは安定した黒字化を目指すよう方針を転換。

■ 精密化学品（単体特殊ガス）：達成予想 87%

AI関連以外の半導体は市場の回復が緩やかであり、中計で想定した需要水準を下回る。
また、渋川工場火災事故に伴うNF3の販売減もあり、計画未達の見通しである。

■ 精密化学品（除く単体特殊ガス）：達成予想 34%

大部分を占める電池材料は、EV市場成長の鈍化と競争の激化により計画から大きく乖離。
また、このような市況を受けライセンスビジネスも後倒し。

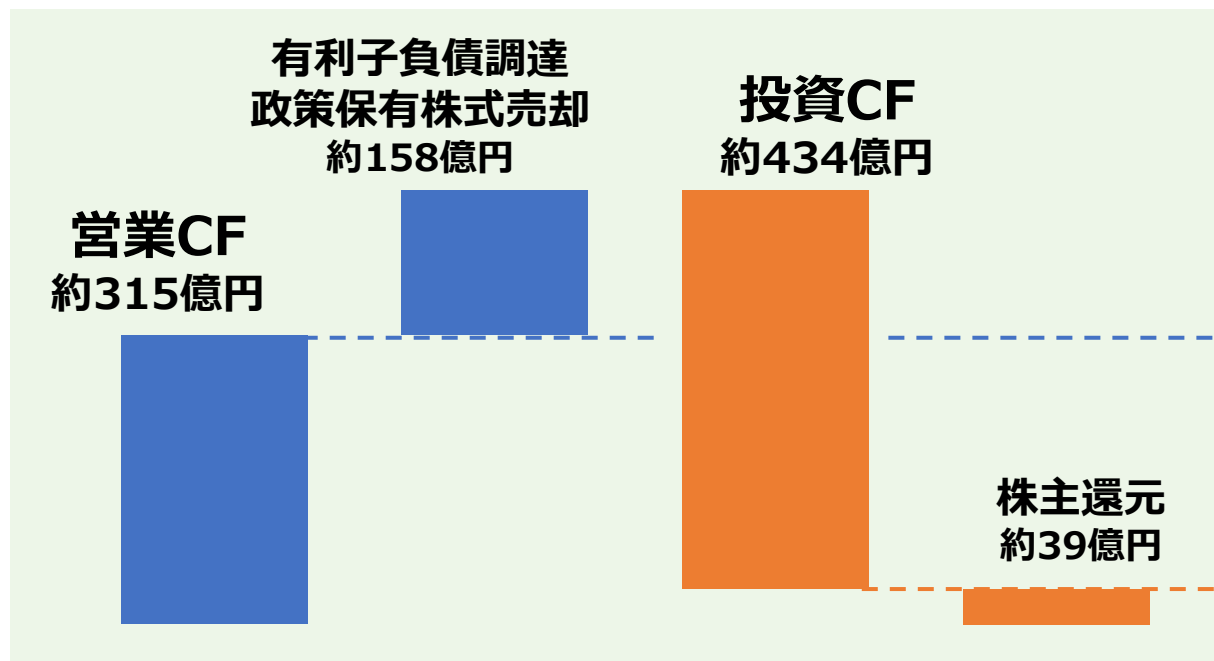
⇒ 電池材料はサプライチェーンの脱中国依存の流れを受け**2027年3月期より大幅な改善を見込む**

キャッシュアロケーション



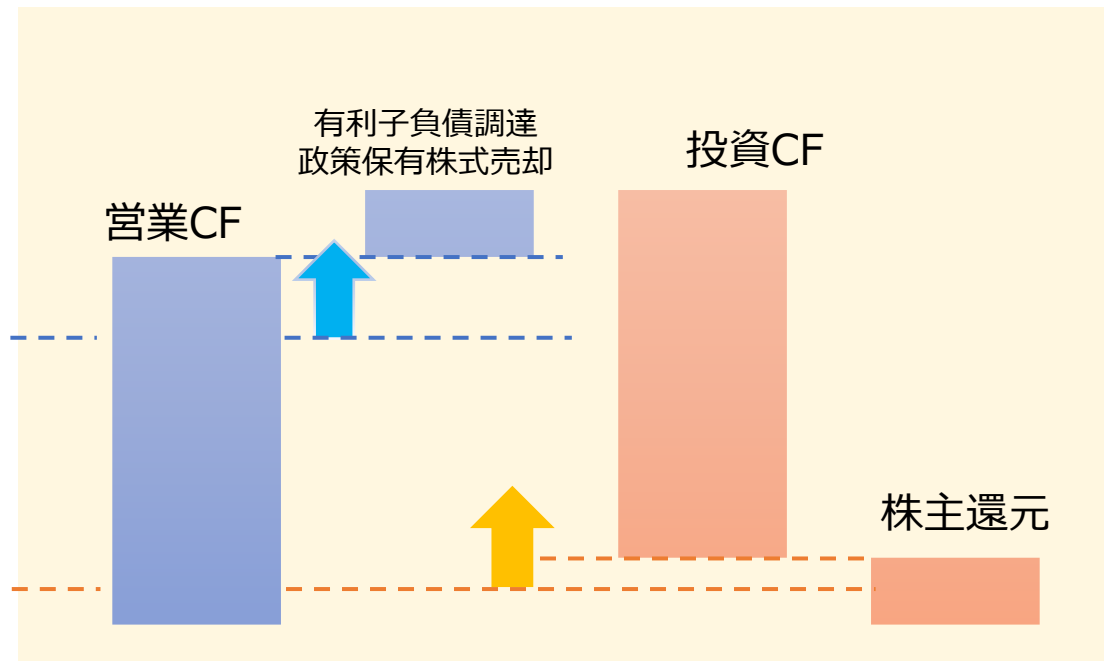
関東電化工業
KANTO DENKA KOGYO

【2022～2024年度 実績】



- ❑ 2025年3月末の自己資本比率は53.4%であり、概ね適正水準と認識
- ❑ 前中計期間から2022-24年度にかけては大型投資が集中し、営業CFを超過する投資が継続

【2025～2026年度 イメージ】

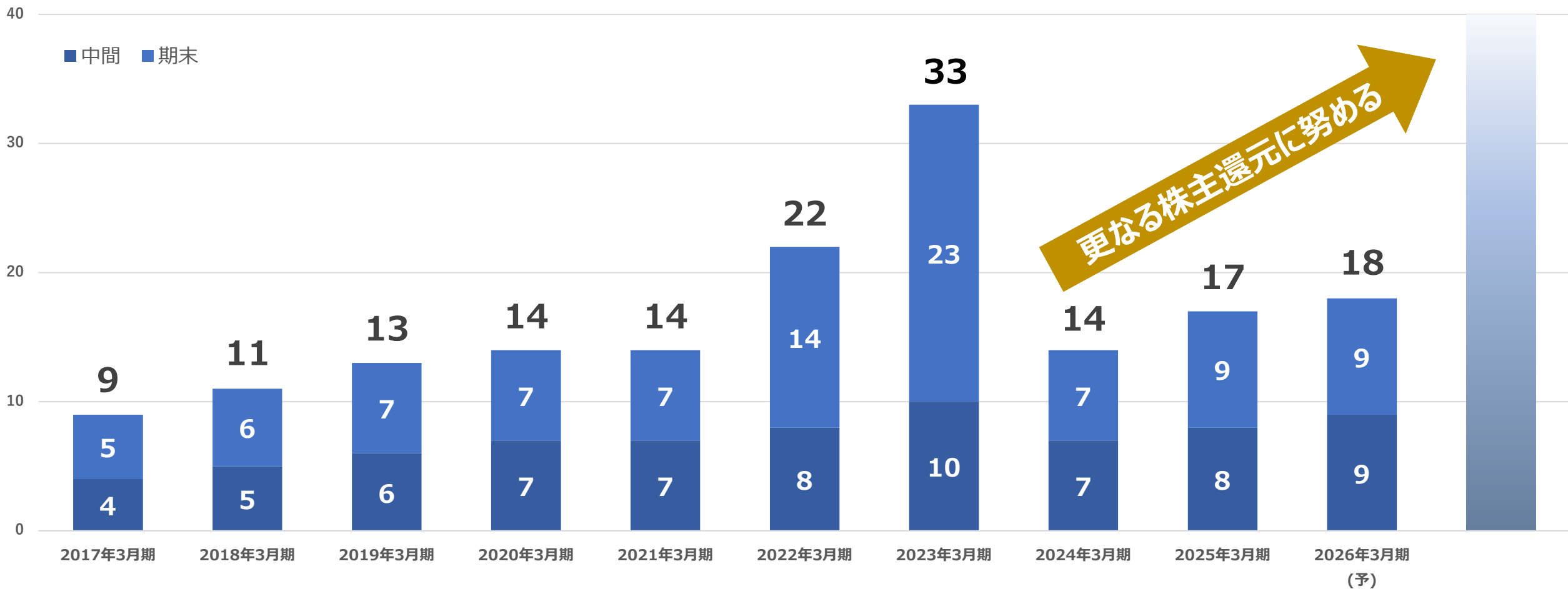


- ❑ 投資が一巡する2025年度以降は、営業CFと投資CFのバランスが改善する見込みのため、株主還元の向上に努める

現在の配当方針：連結配当性向30%以上

配当金の推移

- ・連結配当性向30%以上
- ・投融资とのバランスを考慮して適正な株主還元を行う



当社の強み

- 高純度フッ素ガスを始め、長い歴史で培った豊富なフッ素化学品合成技術により、一貫した事業体制を構築
- 国内外に製造拠点をもち、各国の半導体メーカーのニーズに迅速に対応できる柔軟な供給体制を構築
- 半導体メーカー、装置メーカーと共同で研究開発を進めることにより、先端技術をリードする製品開発を推進

事業の成長性

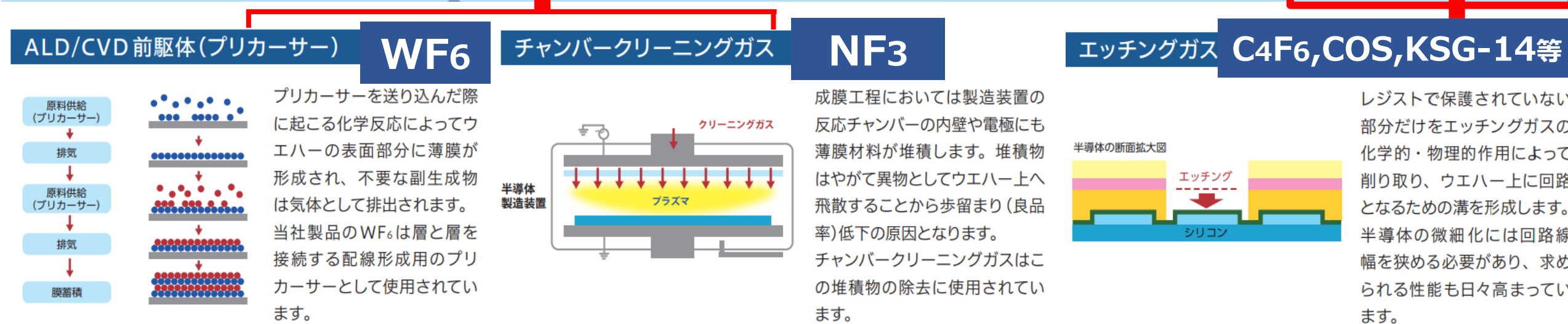
- 半導体の微細化や多層化が進み、特殊ガスの種類、使用量増加が見込まれる
- 新たな機能を持つ新規特殊ガスのニーズが増加し、KSGシリーズなどの拡販機会の増加が見込まれる
- サプライチェーンの脱中国化という大きな流れにより、米国市場で新たな需要拡大が見込まれる

株主還元

- 配当方針は連結配当性向30%以上
- 設備投資が一巡し、キャッシュフローの改善が見込まれる

appendix

半導体製造工程



半導体市場の拡大

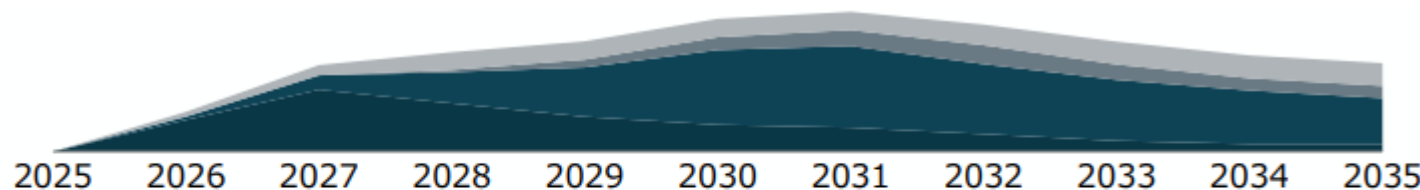
- ・半導体は微細化、高積層化が進む
- ・メモリー半導体の需要が大幅に増加



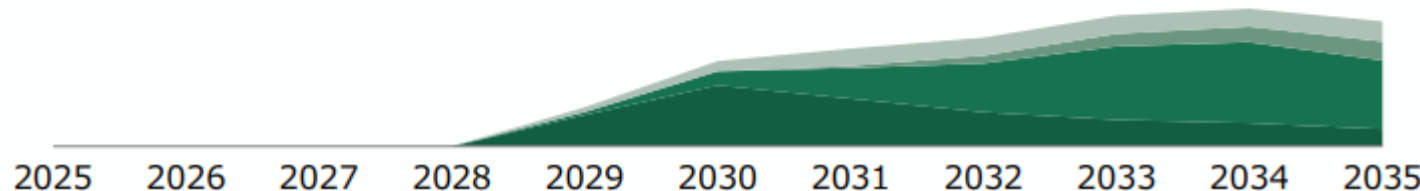
特殊ガスの使用量の増加
新たな機能を持つ新規特殊ガスの需要増加

出典：令和7年12月23日 経済産業省 半導体・デジタル産業戦略の今後の方向性より当社作成

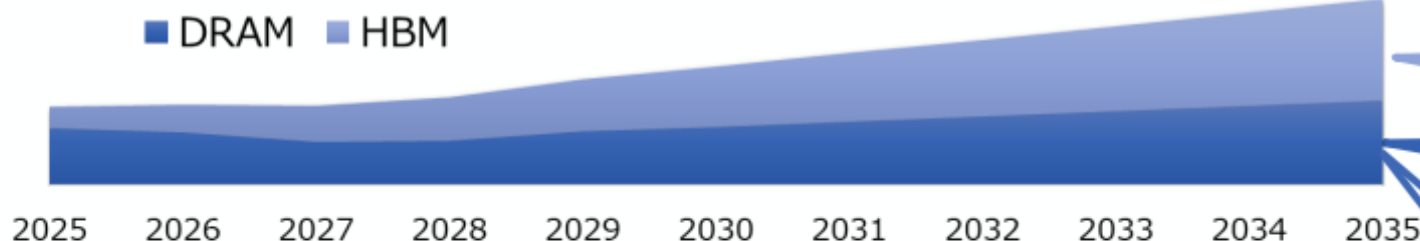
2nm半導体



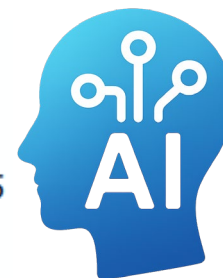
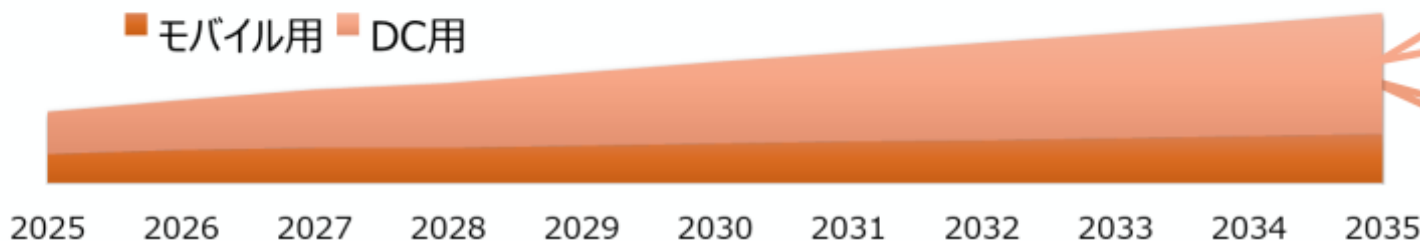
1.4nm半導体



DRAM



NAND



生成AI



データセンター



自動運転

①次世代HBM
・微細化、高積層化
・革新メモリ技術

②次世代DRAM
・微細化
・3次元化

③次世代メモリ
・不揮発性
・高速読み書き

④次世代NAND
・高積層化、高信頼性
・高速転送速度

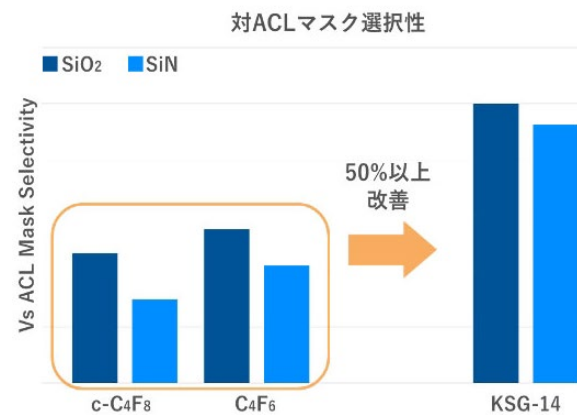
- ・KSG : KANTO DENKA Specialty Gas
- ・「半導体製造プロセスに対する高い性能」と「低環境負荷」を実現

KSG[®]シリーズのコンセプト

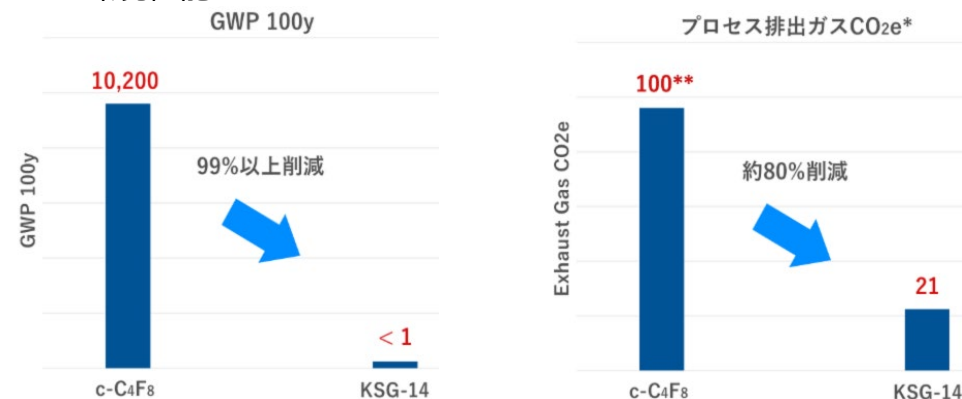


KSG-14

■ エッチング性能



■ 環境性能



注意事項

- 本資料は、金融商品取引法等のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 本資料の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なります。

【お問い合わせ先】

関東電化工業株式会社 広報・IR室

TEL 03-4236-8804

E-mail ir_info@kantodenka.co.jp